

Сделанное в самом начале предположение о малости коэффициента трения существенно упростило вывод этого соотношения, так как можно было не следить за выполнением условия затухания флуктуаций

$$|\Delta(k - k_m) + (k - k_m)| < |k - k_m|.$$

Необходимо подчеркнуть, что в ряду стационарных амплитуд условие (11) может не выполняться для некоторых из них, что и объясняет пропуски в ряду устойчивых амплитуд, наблюдаемые экспериментально.

Условие устойчивости колебаний осциллятора (11) не изменится, если мы искусственно положим  $\psi \equiv \psi_m$ . Это наблюдение позволяет нам утверждать, что колебания осциллятора для случая нечетной функции  $Q(q)$  включают в себя ряд стационарных амплитуд  $k_m$ , появление которых связано не с аргументными колебаниями, как это имело место в работе [1] для случая четной функции  $Q(q)$ , поскольку фазовые соотношения в рассмотренном случае не являются определяющими.

Устойчивость колебаний осциллятора в пределах одной зоны позволяет через изучение динамики амплитуды каждого единичного колебания рассмотреть стохастизацию движения под действием шумового сигнала.

Авторы приносят свою благодарность В. В. Добросельскому и Л. П. Хохрину за полезные обсуждения.

### Литература

- [1] Некоторые вопросы возбуждения незатухающих колебаний, вып. 2. Владимир, 1874. 134 с.
- [2] Вайнштейн Л. А., Вакман Д. Е. Разделение частот в теории колебаний и волн. М.: Наука, 1983. 320 с.
- [3] Ахиезер Н. И. Элементы теории эллиптических функций. М.: Наука, 1970. 304 с.
- [4] Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. М.: Наука, 1981. 798 с.
- [5] Ефимов А. В. Математический анализ (специальные разделы), т. 1, М.: Высшая школа, 1980. 280 с.

Отраслевая научно-исследовательская  
лаборатория дистанционной диагностики  
ИОФ—ГЕОХИ АН СССР при НГПИ  
Наманган

Поступило в Редакцию  
3 ноября 1987 г.  
В окончательной редакции  
15 марта 1988 г.

УДК 537.311.33

Журнал технической физики, т. 58, в. 11, 1988

### ЭФФЕКТ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СИММЕТРИЧНОЙ $p^+pn^-$ -СТРУКТУРЕ

В. И. Брилевский, И. В. Грехов, В. М. Ефанов, А. Ф. Кардо-Сысоев, И. Г. Чашников,  
Д. И. Шеметило

В [1] был обнаружен эффект быстрого восстановления обратного напряжения на высоковольтных  $p^+pn^-$ -структуратах при переключении короткого импульса прямого тока (порядка нескольких сот пикосекунд) на обратный. Исследования нестационарных полевых процессов инжеекции и рассасывания плазмы в несимметричных  $p^+p$ -переходах с коэффициентом инжеекции  $\gamma \approx 1$  [2] показали следующее: при малой длительности ( $\tau^+$ ) прямого тока размер «диффузионной», сильно обогащенной подвижными носителями заряда области у  $p^+n$ -перехода мал и имеет характерный размер  $L_p \approx \sqrt{D_p \tau^+}$ , где  $D_p$  — коэффициент диффузии дырок. При протекании обратного тока неравновесные носители заряда выносятся из  $n$ -базы практически полностью за время, в течение которого падение напряжения на области объемного заряда (ООЗ) у  $p^+ - n$ -перехода мало по сравнению с падением напряжения на всей структуре.

После удаления неравновесных электронов и дырок напряжение на  $p^+n$ -переходе восстанавливается в процессе выноса из  $n$ -базы равновесных электронов, а скорость роста напряжения на ней определяется скоростью расширения ООЗ, т. е. скоростью движения электронов в поле, созданном обратным током, и может достигать величины более  $10^{12}$  В/с. В этом и состоит эффект быстрого восстановления обратного напряжения на несимметричной  $p^+n$ -структуре.

ture. Увеличение длительности прямого тока ведет к увеличению размера «диффузионной» области. При этом уже на этапе выноса неравновесных носителей заряда падение напряжения на ОЗ достигает большой величины, и восстановление полного напряжения на структуре происходит в условиях выноса неосновных носителей заряда. Этот процесс, рассмотренный в [3], является значительно более медленным, чем восстановление обратного напряжения в условиях выноса основных носителей заряда.

Цель настоящей работы показать, что для симметричных  $p^+pnn^+$ -структур эффект быстрого восстановления обратного напряжения сохраняется и при больших длительностях импульсов прямого тока. Сравнительно медленное возрастание напряжения на такой структуре в процессе выноса неравновесных носителей заряда исключается компенсацией объемного заряда у  $p-n$ -перехода встречными потоками электронов и дырок.

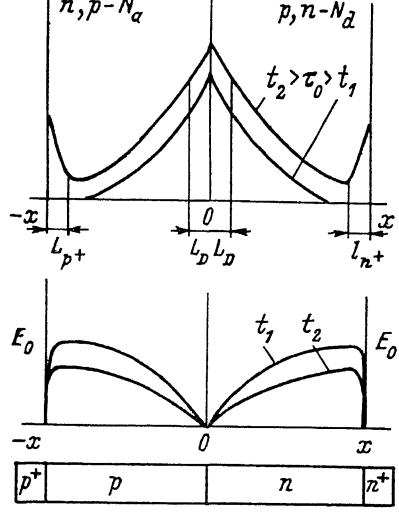


Рис. 1. Распределение электронов, дырок и полей на этапе прямого тока.

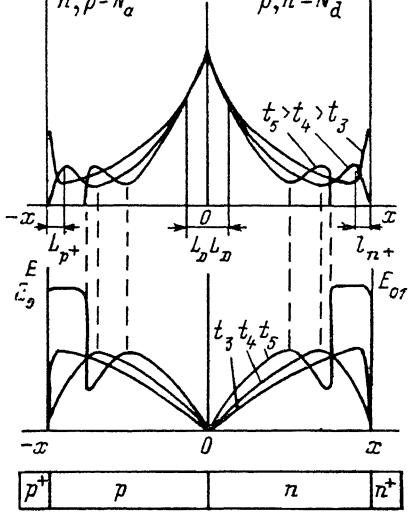


Рис. 2. Распределение электронов, дырок и полей на этапе обратного тока.

Рассмотрим симметричную  $p^+pnn^+$ -структуру (рис. 1), в которой уровни легирования  $n$ - и  $p$ -областей равны, т. е.  $N_d = N_a$ . Для простоты примем подвижности  $\mu$  и коэффициенты диффузии  $D$  электронов и дырок равными. Принимаем также, что реализуется режим генератора тока для прямого и обратного токов с амплитудами, не превышающими значения  $j_s = qN_d v_s$ , где  $v_s$  — насыщенная скорость дрейфа электронов и дырок. Так как длительность рассматриваемых процессов меньше времени жизни неравновесных подвижных носителей заряда, то рекомбинацией пренебрегаем. В дальнейшем анализе физических процессов будем использовать нестационарную полевую модель двойной инжекции, рассмотренную в работе [2].

Пусть вначале через диод пропускается импульс прямого тока длительностью  $\tau^+$  и плотности  $j^+$ . Согласно [2], в базе диода, а в нашем случае в  $n$ - и  $p$ -областях, возникает электрическое поле  $E_0 = j^+ / qN_d \mu$  и начинается распространение концентрационных волн неосновных носителей: дырок в  $n$ -области и электронов в  $p$ -области (рис. 1). В модулированных частях  $n$ - и  $p$ -областей, т. е. там, где появились неосновные носители, поле  $E(x, t) = E_0 \sqrt{|x|/t}$ , где  $x$  — текущая координата,  $t$  — время. Через пролетное время  $\tau_0 = W/\mu E_0$  у обоих контактов станут образовываться диффузионные области с характерным размером  $L_{n^+} = L_{p^+} = \sqrt{D(t - \tau_0)}$  (рис. 1). Все эти процессы аналогичны процессам в  $n$ -базе несимметричного  $p^+nn^+$ -диода, за исключением того, что в симметричной  $p^+pnn^+$ -структуре существуют две подобные базы ( $n$ - и  $p$ -области).

Как отмечалось в [2], полевая область, в которой  $E(x, t) = E_0 \sqrt{|x|/t}$ , а  $n(x, t) \sim \sqrt{t/|x|}$  вблизи  $p^+n$ -перехода всегда переходит в область с характерным размером  $L_p = \sqrt{Dt}$ , где существует диффузионный перенос и нарушаются указанные выше соотношения. Точно так же это будет происходить и в симметричной структуре, но с обеих сторон  $pn$ -перехода (рис. 1).

Разница с несимметричным  $p^+n$ -переходом состоит также и в том, что для симметричного  $pn$ -перехода коэффициент инжекции в рамках принятых нами приближений будет равен  $\gamma = -1/2$ , а не 1, как для  $p^+n$ -перехода. Это означает, что при одинаковой плотности и длительности импульса прямого тока в  $n$ -базе  $p^+p-nn^+$ -структуре накапливается вдвое меньший заряд, чем заряд в  $n$ -базе  $p^+nn^+$ -диода. В принципе это должно отразиться на распределении электронно-дырочной плазмы, т. е. на функциях  $n(x, t)$  и  $E(r, t)$ . Однако, учитывая, что распределение плазмы в полевых областях не очень чувствительно к граничной концентрации [4] и что большая часть инжектированных носителей накапливается в приконтактных диффузионных областях  $L_p$  [2], приведенные выше соотношения для поля и концентрации будут справедливы там, где преобладает полевой перенос электронов и дырок. Наиболее сильно уменьшение коэффициента инжекции должно сказаться на значении концентрации на границе  $p-n$ -перехода, причем она будет меньше по сравнению с концентрацией  $p^+n$ -перехода. Из решения стационарной задачи для симметричного  $pn$ -перехода с рекомбинационными контактами известно, что концентрация плазмы на границе  $p-n$ -перехода  $P_m \sim (j^+)^{1/2}$  и может значительно

превысить концентрацию примеси  $P_m \gg N_d$  [5]. Следует ожидать, что при соответствующих плотностях тока условие  $P_m \gg N_d$  должно выполняться и в переходном процессе.

Рассмотрим далее процесс рассасывания накопленной плазмы при протекании обратного тока. После переключения тока с прямого на обратный в  $p^+pnn^+$ -структуре, также как и в  $p^+nn^+$ -диоде [2], начнутся перераспределения полей и концентраций в полевых областях  $n$ - и  $p$ -баз и рассасывание зарядов в диффузионных приконтактных областях  $L_{n+}$ ,  $L_{p+}$  (рис. 2). После истощения зарядов в приконтактных диффузионных областях  $L_{n+}$ ,  $L_{p+}$  здесь возникнут концентрационные разрывы, которые будут двигаться в сторону  $p-n$ -перехода, оставляя за собой области, свободные от неравновесных носителей заряда, поле в которых  $E_0 = j^-/qN_d\mu$ , где  $j^-$  — плотность обратного тока.

Рассмотрим процессы, происходящие у  $p-n$ -перехода при прохождении обратного тока,

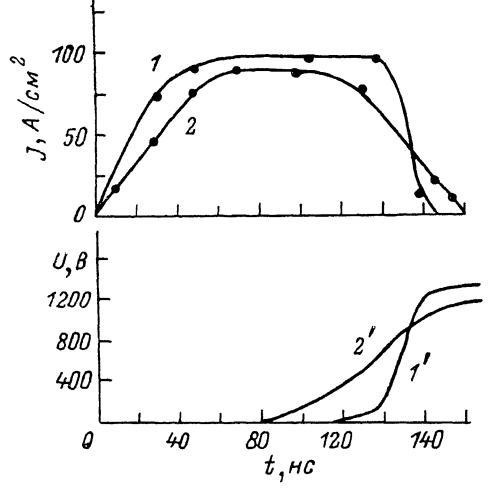


Рис. 4. Обратный ток и напряжение при рассасывании накопленного прямым током заряда на  $p^+pnn^+$ -структуре (1, 1') и на  $p^+nn^+$ -структуре (кривые 2, 2').

с точки зрения изменения заряда  $Q$  неравновесных электропроводов и дырок в диффузионных областях  $L_p$ . Вначале остановимся на случае несимметричного  $p^+n$ -перехода с  $\gamma = 1$ . После переключения прямого тока на обратный заряд  $Q$  в области  $L_p$  начнет уменьшаться. Это очевидно, если рассмотреть баланс токов через границы области: у  $p^+$ -контакта ток является чисто дырочным  $j_p(0) = j^-$ , а у границы с полевой областью при  $|x| = L_p$  соотношение электронного и дырочного токов определяется отношением подвижностей электропроводов и дырок  $b = \mu_n/\mu_p$  (в нашем случае  $b = 1$ ) и их концентрациями  $j_p(L_p) = q\mu_p E \cdot p$ ,  $j_n(L_p) = q\mu_n E (p + N_d)$ . Учитывая, что потоки электронов и дырок направлены в разные стороны, получаем изменение заряда каждого знака в рамках квазинейтральности  $\Delta Q = j_n(L_p) \Delta t$ . Уменьшение концентрации плазмы в диффузионной области в конце концов приведет к возникновению ОЗУ у  $p^+n$ -перехода, которая будет в дальнейшем расширяться.

В симметричном  $p-n$ -переходе с  $\gamma = 0.5$  динамика изменения заряда  $Q$  в диффузионных областях будет иной. На границе с полевой областью соотношение электронного и дырочного токов аналогично рассмотренному выше. На самом же  $p-n$ -переходе в силу принятой симметрии электронный и дырочный токи равны. Пренебрегая концентрациями легирующих примесей в  $p$ - и  $n$ -слоях (высокий уровень инжекции), получаем  $\Delta Q = 0$ . Это означает, что в рамках принятых приближений заряды, накопленные в диффузионных областях, начнут рассасываться только после рассасывания зарядов в полевых областях.

Реально в кремнии  $b \approx 3$  и в симметричном  $p-n$ -переходе  $\gamma \neq 0.5$ . Однако, несмотря на это, здесь следует ожидать более медленное рассасывание диффузионных областей и, как следствие, более позднее возникновение ОЗУ. Внешне это должно проявиться в более длительной фазе высокой обратной проводимости по сравнению с  $p^+nn^+$ -диодом.

Полученные выводы экспериментально проверялись на «квазисимметричном»  $p^+pnn^-$ -диоде с глубиной залегания  $p-n$ -перехода примерно 100 мк, полученного диффузней алюминия с поверхностной концентрацией  $N_s = 10^{17}$  см<sup>-3</sup>. Исходный кремний имел уровень легирования  $N_d = 3 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup>.

Для сравнения также исследовался диод с резким  $p^+n$ -переходом, имевшим толщину базы, равную суммарной толщине  $p$ - и  $n$ -областей  $p^+pnn^+$ -структуры.

В экспериментах через диоды в начале пропускался импульс прямого тока длительностью 1 мкс и амплитудой 0.5 А, который затем сменялся импульсом обратной полярности. На рис. 3 показаны ток и напряжение на приборах при протекании обратного тока. Как следует из рис. 3, напряжение на  $p^+pnn^+$ -структуре начинает возрастать позже и со скоростью почти на порядок большей, чем на  $p^+nn^+$ -диоде.

Таким образом, эксперимент подтверждает ранее сделанные выводы об особенностях восстановления обратного напряжения на симметричных  $p-n$ -переходах.

### Литература

- [1] Грехов И. В., Ефанов В. М., Кардо-Сысоев А. Ф., Шендерей С. В. Письма ЖТФ, 1983, т. 9, № 7, с. 435—439.
- [2] Ефанов В. М., Кардо-Сысоев А. Ф., Смирнова И. А. ФТП, 1987, т. 21, № 4, с. 620—625.
- [3] Benda H., Spenke E. Proc. IEEE, 1967, v. 55, N 8, p. 1331—1354.
- [4] Лампарт М., Марк П. Инжекционные токи в твердых телах / Под ред. С. М. Рывкина. М.: Мир, 1973. 416 с.
- [5] Васильева А. Б., Кардо-Сысоев А. Ф., Стельмак В. Г. ФТП, т. 10, № 7, 1976, с. 1321—1325.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
3 ноября 1987 г.

УДК 536

Журнал технической физики, т. 58, в. 11, 1988

## ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РАЗЛИЧИЯ КУЛЬБАКА В ПРОЦЕССЕ САМООРГАНИЗАЦИИ. I-ТЕОРЕМА

Р. Г. Зарипов

В работе [1] рассматривается изменение энтропии Больцмана—Гиббса для последовательных стационарных состояний, которые характерны при переходе через порог генерации в область развитой генерации. В результате формулируется важная  $S$ -теорема, утверждающая уменьшение перенормированной (соответствующей одинаковым значениям средней энергии) энтропии. Поскольку энтропия определяет количественную меру статистической неопределенности в микросостояниях системы, то уменьшение ее указывает на увеличение степени упорядоченности. В дальнейшем  $S$ -теорема подтверждается для различных самоорганизующих систем и в [2] доказывается для общего случая.

В работе [3] предложен неравновесно-информационный подход к исследованию переходов системы между различными состояниями. Исходной величиной является информация различия Кульбака [4], которая характеризует точность различия между состояниями и определяет количественную меру статистической упорядоченности в микросостояниях системы. При этом раскрывается взаимосвязь  $H$ -функции Больцмана с минимальной информацией различия. Представляется необходимым применение указанного подхода [3] к рассмотрению процесса самоорганизации [2]. Это позволяет утверждать в общем случае о возрастании информации различия ( $I$ -теорема). В случае одновременного изменения управляющих параметров приводится система уравнений для нахождения параметров, по которым происходит процесс самоорганизации.

### 1. Информация различия Кульбака и теорема Гиббса

Рассмотрим переход между произвольным состоянием замкнутой системы, описываемом функцией распределения  $f(X)$ , и состоянием с каноническим распределением Гиббса [5]